This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(11)Publication number:

2000-304906

(43)Date of publication of application: 02.11.2000

(51)Int.CI.

G02B 3/00 H01L 27/14 H01L 31/0232 HO4N 5/335

(21)Application number: 11-116472

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

23.04.1999

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a microlens array which

objective solid-state image pickup element 20 with a microlens

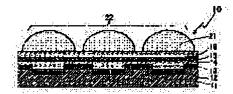
(72)Inventor: KOGA OSAMU

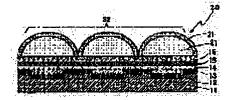
ISHIMATSU TADASHI FUKUYOSHI KENZO

(54) MICROLENS ARRAY FOR SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT AND SOLID-STATE IMAGE PICKUP **ELEMENT USING THE SAME**

(57)Abstract:

enhances the light receiving efficiency of the light receiving part of a solid-state image pickup element and enhances the sensitivity and image quality of a solid-state image pickup device. SOLUTION: A light receiving part 12, a light shielding part 13, a flattening layer 14, a color filter layer 15 and an overcoat layer 16 are formed on a semiconductor substrate 11, a resin pattern layer is (a) formed by using a positive type resist adjusted so as to ensure an extinction coefficient of 0.57 × 10-3 at 450 nm wavelength and convex microlenses 21 are formed by heating and softening the resin pattern layer at 130° C to obtain the objective solid-state image pickup element 10 with a microlens array 22. When a filling rate improving layer 31 having 0.09 µm thickness is further formed on the microlenses 21 using an acrylic resin adjusted so as to ensure a refractive index of 1.45 at 450 nm wavelength, the





(b)

LEGAL STATUS

array 32 is obtained.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-304906

(P2000-304906A)

(43) 公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

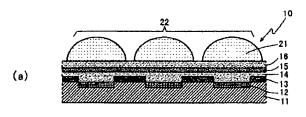
(51) Int. C1. 7	識別	記号		FΙ			テーマコート^(参考)
G 0 2 B	3/00			G 0 2 B	3/00	Α	4M118	
HOIL	27/14			H 0 4 N	5/335	V	5C024	
	31/0232			H01L	27/14	D	5F088	
H 0 4 N	5/335				31/02	D		
	審查請求 未請求	請求項の数5	ΟL		,- ,,,,,	(全6頁)		
(21)出願番号	特願平11-	116472		(71)出願人		193 刷株式会社		
(22)出願日	平成11年4	月23日 (1999. 4. 23)		(20) ₹¢ BB 1	東京都	台東区台東1丁	回5番1号	
				(72)発明者		台東区台東1丁	目5番1号	凸版印刷
				(72)発明者	石松	忠		
					東京都 株式会	台東区台東1丁 社内	月5番1号	凸版印刷
				(72)発明者				
				,		台東区台東1丁	月5番1号	凸版印刷
							最	終頁に続く

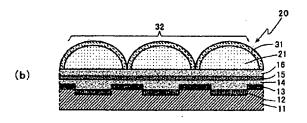
(54) 【発明の名称】固体撮像素子用マイクロレンズアレイ及びそれを用いた固体撮像素子

(57)【要約】

【課題】固体撮像素子の受光部の受光効率を上げ、固体 撮像装置の感度や画質を向上できるマイクロレンズアレ イ及び固体撮像素子を提供することを目的とする。

【解決手段】半導体基板11に受光部12、遮光部13、平坦化層14、カラーフイルター層15及びオーバーコート層16を形成し、あらかじめ波長450mmでの消衰係数が0.57×10⁻⁻⁻になるように調整されたポジ型レジスト(JSR(株)製)にて樹脂パターン層を形成し、130℃で加熱・軟化させることにより凸レンズ状のマイクロレンズ21及びマイクロレンズアレイ22を有する固体撮像素子10を得る。さらに、マイクロレンズ21上に、あらかじめ波長450mmでの屈折率が1.45になるように調合されたアクリル系樹脂にて0.09μm厚の充填率改善層31を形成したマイクロレンズアレイ32を有する固体撮像素子20を得る。





(11)Publication number:

2000-275405

(43)Date of publication of application: 06.10.2000

(51)Int.CI.

G02B 3/00 B29C 33/38 B29D 11/00 // B29L 11:00

(21)Application number: 11-085040

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

29.03.1999

(72)Inventor: SHIMADA YASUHIRO

TEJIMA TAKAYUKI

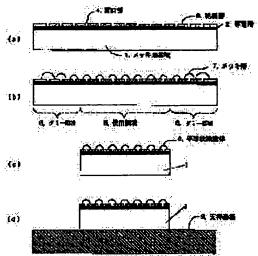
USHIJIMA TAKASHI YAGI TAKAYUKI

(54) MANUFACTURE OF MICROSTRUCTURE ARRAY, MANUFACTURE OF DIE FOR MICRO-LENS ARRAY, AND MANUFACTURE OF MICRO-LENS ARRAY WITH USE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a microstructure array, such as a micro-lens array, facilitating enlargement and manufacturing processes, and high in controlling, relatively inexpensive, and small in in-plane distribution.

SOLUTION: This manufacturing method for a microstructure array includes the processes of: forming an insulating layer 3 on a conductive portion 2 of a substrate 1, forming an opening 4 having a periodic repetitive array pattern on the insulating layer 3, and forming an electrodeposition layer 7 on the opening 4 and the insulating layer 3 through the opening 4 by the electrodeposition of the conductive portion 2 as a negative or positive electrode. The opening 4 is formed both on the periphery of a use area 5 in the microstructure, and in a dummy area 6 in series with the use area 5 and having an array pattern similar thereto.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-275405 (P2000-275405A) (43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

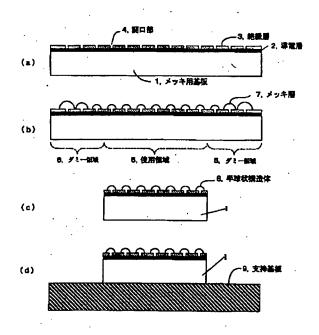
(51) Int. Cl. 7	識別記号			FI				テーマコード(参孝	考)
G 0 2 B	3/00			G 0 2 B	3/00		Α	4F202	
B 2 9 C	33/38			B 2 9 C	33/38			4F213	
B 2 9 D	11/00			B 2 9 D	11/00				
// B 2 9 L	11:00								
	審查請求 未請求 請求	杉項の数26	OL			(全1	3]	()	
(21)出願番号	特願平11-85040			(71)出願人	00000	1007			
					キヤノ	ソン株式会社	Ł		
(22)出顧日	平成11年3月29日	(1999. 3. 29)			東京者	7大田区下ま	1子3	3丁目30番2号	
	•		-	(72)発明者	島田	康弘			
		-			東京者	『大田区下 歩	子	3丁目30番2号	キヤノ
					ン株式	大会社内			
				(72)発明者	手島	隆行			
					東京者	水田区下す	1子3	3丁目30番2号	キヤノ
					ン株式	弋会社内			
				(74)代理人	10008	6483			
					弁理士	- 加藤 -	-男		
								最終頁	に続く

(54) 【発明の名称】マイクロ構造体アレイの作製方法、マイクロレンズアレイ用金型の作製方法、及びこれを用いたマイクロレンズアレイの作製方法

(57)【要約】

【課題】サイズの面内分布の小さいマイクロ構造体アレイの作製方法、マイクロレンズアレイ用金型の作製方法、金型を用いたマイクロレンズアレイの作製方法、マイクロ構造体アレイである。

【解決手段】マイクロ構造体アレイの作製方法は、基板 1の導電性部2上に絶縁層3を形成する工程、絶縁層3 に周期的な繰り返し配列パターンを有する開口部4を形 成する工程、導電性部2を陰極ないし陽極として電着に より開口部4を通じて開口部4及び絶縁層3上に電着層 7を形成する工程を有する。開口部4が、マイクロ構造 体の使用領域5の周囲に、使用領域5に連続して使用領 域5と同様の配列パターンを有するダミー領域6にも形 成される。



(11)Publication number:

11-211902

(43)Date of publication of application: 06.08.1999

(51)Int.CI.

G02B 3/00 C03C 17/32

(21)Application number: 10-009813

(71)Applicant: MICRO OPT:KK

(22)Date of filing:

21.01.1998

(72)Inventor: HAMANAKA KENJIRO

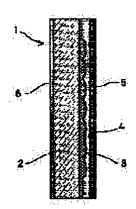
MORIO KENJI

(54) FLAT PLANE TYPE MICROLENS ARRAY

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the warpage of a flat plate type microlens array which occurs in the shrinkage at the time of curing of a UV curing resin.

SOLUTION: Microconvex lens groups 3 consisting of a UV curing resin of a high refractive index are formed on one surface side of the base glass 2 of the flat plate type microlens array 1 and cover glass 5 is adhered via an adhesive layer 4 consisting of the UV curing resin of a low refractive index to the surface on the side formed with these microconvex lens groups 3. The UV curing resin film 6 is further formed on the surface of the base glass 2 opposite to the side provided with the microconvex lens group 3. The shrinkage at the time the UV curing resin applied on the surface of the base glass 2 opposite to the side provided with the microconvex lens groups 3 cures and the shrinkage at the time the UV curing resin constituting the microconvex lens groups cures are offset and the warpage quantity as the entire part of the flat plate type microlens array 1 is decreased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

· (19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-211902

(43)公開日 平成11年(1999)8月6日

(51) Int. Cl. 6		識別記号	FΙ		
G 0 2 B	3/00		G 0 2 B	3/00	Α
C 0 3 C	17/32		C 0 3 C	17/32	Α

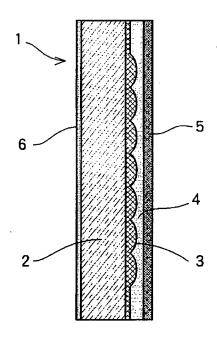
(72)発明者 浜中 賢二郎 神奈川県相模原市西橋本5-8- 社マイクロオプト内 (72)発明者 森尾 健二 神奈川県相模原市西橋本5-8- 社マイクロオプト内	 7	L (全4頁)	
(72)発明者 浜中 賢二郎 神奈川県相模原市西橋本5-8- 社マイクロオプト内 (72)発明者 森尾 健二 神奈川県相模原市西橋本5-8- 社マイクロオプト内			
(72)発明者 森尾 健二 神奈川県相模原市西橋本5-8- 社マイクロオプト内		神奈川県相模原市西橋本5-8-1	
		(72)発明者 森尾 健二 神奈川県相模原市西橋本5-8-1	株式会
(74)代理人 弁理士 小山 有 (外1名)		(74)代理人 弁理士 小山 有 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 平板型マイクロレンズアレイ

(57)【要約】

【課題】 紫外線硬化樹脂の硬化時の収縮に起因する平 板型マイクロレンズアレイの反りを防止する。

【解決手段】 平板型マイクロレンズアレイ1のベース ガラス2の一面側には、高屈折率の紫外線硬化樹脂から なる微小凸レンズ群3が形成され、この微小凸レンズ群 3を形成した側の表面に低屈折率の紫外線硬化樹脂から なる接着層4を介してカバーガラス5が接着され、更に 前記ベースガラス2の微小凸レンズ群3が設けられた側 の反対側面には紫外線硬化樹脂膜6が形成されている。



(11)Publication number:

06-208005

(43)Date of publication of application: 26.07.1994

(51)Int.CI.

G02B 3/00

(21)Application number: 05-309727

(71)Applicant: OMRON CORP

(22)Date of filing:

15.11.1993 (72)Inventor

(72)Inventor: NISHIZAKI OSAMU

AOYAMA SHIGERU

SHINOHARA MASAYUKI

(30)Priority

Priority number: 04332393

Priority date: 17.11.1992

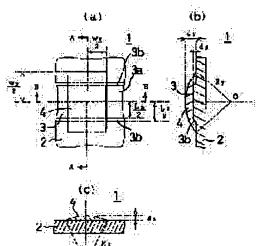
Priority country: JP

(54) MICROLENS ARRAY, MICROELENSES AND THEIR MANUFACTURE, AND STAMPER FOR MANUFACTURING MICROLENSES

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the top surface of a lens body nearly equal in curvature between two directions wherein the lens diameter is different by forming the lens body in a specific shape on a substrate from above a curvature adjustment part so that the lens body crosses the curvature adjustment part different in height from the top surface of the substrate.

CONSTITUTION: A microlens 1 consists of the transparent substrate 2 and lens body 4 and the refractive index of the substrate 2 is equal to the refractive index of the lens 4. On the substrate 2, the curvature adjustment base 3 which is trapezoidally sectioned and has thickness dp is projected, the width Lb of the curvature adjustment base 3 is narrower than the major axis directional length Wy the length of the curvature adjustment base 3 is longer than at least the minor axis directional length Wx of the lens body 4. The top surface of the curvature adjustment base 3 consists of a top surface 3a which has width La and slanting surfaces 3b on both its sides. The lens body 4 is formed on the top surface of the substrate 2 from above the curvature adjustment base 3 while crossing the curvature adjustment base 3, and major axis direction of the lens body 4 crosses the length direction of the curvature adjustment base 3 almost at right angles.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.09.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3289202

[Date of registration]

22.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

F D

特開平6-208005

(43)公開日 平成6年(1994)7月26日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 3/00 A 8106 - 2 K

審査請求 未請求 請求項の数13

(全14頁)

(21)出願番号

特願平5-309727

(22)出願日

平成5年(1993)11月15日

(31)優先権主張番号 特願平4-332393

(32)優先日

平4(1992)11月17日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000002945

オムロン株式会社

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

(72) 発明者 西崎 修

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72) 発明者 青山 茂

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72) 発明者 篠原 正幸

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(74)代理人 弁理士 中野 雅房

(54) 【発明の名称】マイクロレンズアレイ、マイクロレンズ及びそれらの製造方法、並びに当該マイクロレンズアレイを 製造するためのスタンパ

(57)【要約】

【目的】 長さの異なる線対称軸を有するマイクロレン ズの長軸方向の曲率と短軸方向の曲率をほぼ等しくす

【構成】 基板2の上に断面台形状をした曲率調整台3 を突設する。矩形状をしたレンズ体4の長軸方向を曲率 調整台3の長さ方向と交差させるようにし、かつ、曲率 調整台3を跨がせるようにして基板2の上にレンズ体4 を設ける

